This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP357126175A

PAT-NO: JP357126175A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 57126175 A

TITLE: AMORPHOUS SILICON CARBIDE/AMOROPHOUS SILICON HETERO

JUNCTION

OPTOELECTRIC ELEMENT

PUBN-DATE: August 5, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

HAMAKAWA, YOSHIHIRO OWADA, YOSHIHISA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

KANEGAFUCHI CHEM IND CO LTD N/A

APPL-NO: JP56012313

APPL-DATE: January 29, 1981

INT-CL_(IPC): H01L031/04

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain high optoelectric conversion efficiency when a hetero junction optoelectric element is to be formed by a method wherein a thin film doped with amorphous silicon carbide is ued at least for one side of the P type layer or the N type layer of a P-I-N junction.

CONSTITUTION: When the hetero junction optoelectric element is to be formed, the element having the form to be injected with light from the P type layer side is constituted of glass 19, a transparent electrode 20, a P type a-SiC<SB>x-/SB> layer 21, an I type a-Si layer 22, an N type a-Si

layer 23, and an electrode 24 from the injecting side of light. When light is to be injected in the N type layer side, the element is constituted of a transparent electrode 29, an N type a-Si<SB>1-x</SB>C<SB>x</SB> layer 28, an I

type a-Si layer 27, a P type a-Si layer 26, and an electrode substrate 25 from the light injecting side. In this constitution, the layer indicated with a general expression of a-Si<SB>1-x</SB>C<SB>x</SB> layer is the layer doped

05/13/2002, EAST Version: 1.03.0002

with amorphous silicon carbide, x is selected as 0.05∼0.95, and electric conductivity is made as 10<SP>-8</SP>∼10<SP>-7</SP>Ωcm<SP>-1</SP>. Moreover silane, silane fluoride, hydrocarbon, hydrocarbon fluoride, etc., is used as the material, and is formed to have thickness of 30∼300Å by plasma decomposition, etc.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio

05/13/2002, EAST Version: 1.03.0002

(9) 日本国特許庁 (JP)

印特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭57-126175

 識別記号

庁内整理番号 7021-5F ❸公開 昭和57年(1982)8月5日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 8 頁)

❸アモルフアスシリコンカーバイト / アモルフ アスシリコンヘテロ接合光電素子

@#

图 图56—12313

②出 順 昭56(1981)1月29日 特許法第30条第1項適用 昭和56年1月24日

日刊工業新聞に発表 の発 明 者 浜川圭弘 川西市南花屋敷 3-17-4

神戸市北区大池見山台14-39

⑪出 顧 人 鐘淵化学工業株式会社

大阪市北区中之島3丁目2番4

号

砂代 理 人 弁理士 内田敏彦

明 声 音

1. 発明の名称

アモルフアスシリコンカーパイト/アモルフアス シリコンヘテロ 豪合士電票子

2. 特許請求の範囲

- 1 シラン又はファ化シランのダロー放電分類法で得られるアモルファスシリコンpin級合元電 ボードンかいて、p層又はn層の少なくとも一方でレッシン又はその機場体。ファ化シラン又は関係 はから過ばれる少なくとも一種以上のガスと、ハイドロカーボン。ファ化テルキルシラン又はファ化アルキルシラン又はファ化アルキルシラン又はプロの路場体から過ばれる少なくとも一種以上のガスとの混合物をダロー放電分解して得られる一般式の一郎((i-x)の(x)で示されるアモルファスシリコンカーパイトを用いる事を特徴とするアモルファスシリコンカーパイト/アモルファスシリコンへテロ銀合元電票子。
- 2 旬配の一数大 s Bi (i-x) C(x)で扱わされるア モルファスシリコンカーパイトは、そのアトミ

ックフラクション I が約 0.05 から約 0.95 で ある事を特徴とする特許請求の範囲第 1 項配数 のアモルフアスシリコンカーパイト/アモルフ アスシリコンヘテロ製合党電景子。

- 3 教配アモルフアスシリコンカーパイトは、変のp数ドープ層 個における電気伝導率があるでき(ロ・cm) 以上である事を特徴とする特許論求の範囲第1項又は 第2項配載のアモルフアスシリコンカーパイト プラモルフアスシリゴンヘテロ要合元電票子。
- 4 朝紀アモルフアスグリコンカーパイトは、その原本が約30Åから約300Åのp要ドープ 脚である事を軽数とする特許請求の範囲第1項。 第2項又は第3項記載のアモルフアスシリコン カーパイド/アモルフアスシリコンへテロ接合 全食本子。
- 5 前起アモルフアスクリコンカーパイトは、金 盤にかける電気伝導率が約10⁻¹(の・cs)¹以 上のc盤ドープ層である事を特象とする特許 水の転換第1項又は第1項化率のアモルフアス クリコンカーパイト/アモルフアズクリコンへ

テロ妥合党電票子。

6 割配アモルフアスシリコンカーバイトは、その除みが約30点から300点の a 数ドーブ級である場を特徴とする特許需求の範囲第1項、第3項又は第5項配数のアモルフアスシリコンカーバイト/アモルフアスシリコンヘテロ接合・大電水子。

1. 発明の評論な説明

本発明は、アモルフアスシリコンカーパイト/ アモルフアスシリコンヘテロ最合元電象子に関する。

シラン (818,)のプラズマ分解法で持られるアモルファスシリコンは、V.B.8pear 毎によつて、PH₃ 中 B₂B₄ でドープする事により、その伝導費を大きく女える事ができることが発見され(1976年)、D.B. Garlson 毎によつてアモルファスシリコンを用いた太陽電晶が試作(1976年) されて以来社目を無め、アモルファスシリコン事裏太陽電像の効率を改合する研究が協発に行なわれている。C.1111での研究により、アモルファスシリコン

本発明者は、pin個光電変換の効率を改善する 為に製意研究した結果、シラン又はその誘導体。 フッ化シラン又はその誘導体から選ばれる少なって とも一種以上のガスと、ベイドロカーボン・フック 化ベイドロカーボン・アルキルシラン又はカンフック化 アルキルシラン又はその製薬体を立て、カントープ等調をpin級合物をブラズバイトの カイトープ等調をpin級合物をエッカメバイト カイとも一部以上のカンスを製造する。 レイデスを関係を関係である。 カイン・アスシリコンスが、 レープ等調をpin級合物により効率を カイとも一部のように カイとも一次により効率を なった。 大きることを インテキの光電源子として用いることができる。 以下にその評価を製明する。

不発明のアモルフアスシリコンは、シラン(818人) 又は七の蘇導体又はファ化シラン又はその蘇導体、 又はこれらの混合物と、水果又は水象で春駅した アルゴン、ヘリウム等の不低性ガスとの混合ガス を、若量結合佐又は蘇導結合住による高階使ダロ 一分解又は直後ダロー放電分割することにより得 られる。混合ガス中のシランの機関は、油常 0.5 神臓光電常子の構造としてはショットキーバリヤー環。 pin 型、MIB型、ヘテロ製合器があり、そのうち旬三者が高効率太陽電像として有望使されている。 すなわちショットキーバリャー誰で 5.5 が (D. R. カールソン他、1977年)、MIB型で 4.8 手 (J. I. B. ウィルソン他、1978)の変換効率が過度されている。

pinジャンタション量太陽電池の場合、p製又 はpimでエルフアスシリコンではキャリヤーの身 会が低かく、有効なキャリヤーだならず、また犬 の表収係数が1 層に比べて大きい事からp形での 犬の表収のスが大きい点に関節があつた。

Cのような欠点を改良する為Kインパーテイドpin 数の光音素子が襲撃されている。すなわちの型ア モルフアスシリコン物から光を照射する素子であ る。 Cの菓子はp 機K比べると光の吸収係数が比 数約小さい為K ヤヤ有利と考えられる。しかしこ む n 機アモルフアスシリコンでも光の吸収ロスが ある点ではp親と変りない。

~50%、好せしくは1~20%である。

基板の温度は200~300でが好せしく、透明電板(ITO.8mの。等)を蒸激したガラスや高分子フィルム、金銭等、太陽電池の構成化必要なあらゆる基板が含まれる。

太陽電池の高水線及は、内-1の(4)。(2)に代表 供が示される。(4)は p 供から光を照射するタイプ で、例えばガラスー透明電象-p-1-n-A1 の構成、(4)は n 供から光を照射するタイプで、例 えばステンレスーp-1-n-透明電極の特別で ある。その他、 p層と透明電影の助に称い色維服 をつけえり、 等い金貨階をつけれ構造でもよい。 受は p-1-n 接合を基本とするものであればい かなる構成でもよい。

「日本の無線体、又はフッ化シラン若し(灯) グラン若し(その調導体、又はてわらの混合物の ダロー放電分解で得られる約10⁻¹ 秒以上のキャ リヤー内命で約10¹¹ cm⁻² eV⁻¹ 以下の 同在単位 密度かよび10⁻¹ cm¹/V 以上の品的数をもつ其性・ アモルファスクリコン、(以下、1強4-81という) を1届として、p数とn数ドープ半導体で集合し た pin 総合構造にするわけであるが、不見明では p 耐又は n 粉の少なくとも一方、すなわち先を服 材する例にアモルフアスシリコンカーペイトを用 いる事を特殊とする。 p 離と n 婦の両方に用いて も よい。 又アモルフアスシリコンカーペイトを用 いないドープ解は、上記1 間 a - 81 を p 数で用い る場合は 明期事表 l 族の元素でドープし、 n 種で 用いる場合は 同期事表 V 族の元素でドープすれば よい。

本を明のアモルフアスシリコシカーパイトは、シラン又はその動事体。ファ化シラン又はその動事体。ファ化シラン又はその動事体から過ばれる少なくとも一種以上のガスと、ペイドロカーボン。ファ化ペイドロカーボン。アルキルシラン又はファ化アルキルシラン又はその動事体から過ばれる少なくとも一種以上のガスとの混合物をブラズマ分割。好ましくはダロー放電分析して得られる。上記のシリコン化合物としてはシラン 51日。又は51月2日 11月2日 11

ションエが約0.05から約0.95 である事が好ま しい。 本発明では s-81(j-x)(x)をドーピング して五世又は7世として用いるが、五世ではリン 寺の舞勘半去¥鉄の元象でドーピングする。 具体 的には、 a-Bi_(1-x)O_(x) を作る観に pBi を、何 えばシラン,メタンと共に義合してダロー放電分 鮮して待られる。ドーピング最度だついては、宝 当ての電気伝導率が約10⁻⁷(Ω·cs)⁻¹以上、好ま しくは 10-*(の・四)**以上にせるエラにコントロ ールすれば良い。 通常は a-B1_(1-X)C_(X) 中に 約 0.0 0 1 atom 多から10 atomが 好ましくは 0.005 atomがから 2.0 atomが形いられる。 p型の場合はボロン等の開題事業音楽の元常でド ーピングする。具体的には、 利馬を、何えばシラ ン、メメンと共に混合してダロー放電分類して青 られる。ドーピンダ機度は皇間での電気伝導率が 約 10~ (宿.cm)~ 以上好せしくは 10~ (Ω・cm)~ 1 以上になるようにコンドロールすればよい。 油学 は a-81(1-x) C(x) 中に約0.001 atom 多から10 atom# 好主亡(は 0.005 atom # から 2.0atom#

代表されるシリコンの水果及び/又はフブ化物など がある。炭素化合物としてはファ化メタン CP。又 は 0g アg flzロ+z-g で示されるフロロハイドロカー ボン静海体、又はその不飽和動海体がある。ハイ ドロカーポンとしては、飽和脂肪族ハイドロカー ピン (CnHan+a)。不能和脂肪炭ベイドロカーピン (例えばエチレン、プロピレン等の一般式CaBsa) がある。妻はアモルフアスシリコンカーパイトを 得るえめのシリコン乱としては、 BLの水黒点び/ 又はファ本島等体で高気圧のあるもの。また炭素 旅としては、Cの水水及び/又はファ京鉄導体で 単気圧のあるものでありさえずればいかなるもの でもよいのである。シサコンカーバイドの組象化 ついては、ダロー放電分解して得られる裏の組取・ を用いるは原子数とで原子数の比。例(1-2)で1 で示す。 例えば、 質中の C 肚子 と 町 肚子の初合が l:1の場合 a-81_(a,t)O_(a,t)と示す。 集中の C 菓子や 81 象子の無底比は IMA, SIMS 。オージエ。 エスカ、毎の電子分光によつて求める事ができる。 本色例では a-8i(_{i-x})^C(z)のアトミンクフラク

が用いられる。

本食用の a-81(1-x)C(x) だかいてもB又はFが重要な役割をしている。ファ化シラン・シラン
むグロー放電分類で得られてモルフアスシリコン
中のB又はFと阿御に、ダングリングポントのター マネーターとして飾らく為と考えられる。B及び/又はFの債度は基本値度等の別作条件で大きく飲むるが、本発明では基本値度は200℃~350℃か好ましく。との場合、3 atom 多から約20 atom 多が質中に含まれる。

11開始57 175 (4)

もう1つの代表的な構造は

透明電影/n 数 a-81_(1-X)C_(X)/1型 a-81/p型 a-81/電影の病法で、透明電影像から光を開射する。 n 数 a-81_(1-X)C_(X) の除みば約30 Å から300 Å 好ましくば50 Å ~ 200 Å、1 数 a-81 層の序みば誤定されないが約2500 Å ~ 10000 Å が適常用いられる。 p 数 e-81 層の序みば誤定されないが約150 Å ~ 600 Å が用いられる。 又このp 数 a-81 の代わりに本発明の p 数 a-81_(1-X) C_(X) を用いても良い。透明電影の素材点び差別 低については前向機である。

次に実施的により不発明の効果について説明す。 る。 内径11cmの石英反応管を用い14.56 MHs の高剛線でグロー放電分解を行う。128 a-81 ft。

ン 100 多 $(81_{1}C_{0})$ の場合。変換効率(以下。 すという)4.6 多であるの化的して不発明の $a-81_{(1-X)}$ $G_{(X)}$ を用いると X=0.05 でも $\tau=5.4$ 多 た 場知し、 X=0.2 では $\tau=7.1$ 多 化も改善される。 X=0.4 では $\tau=7.2$ 多 化も返し 0 多 の 多 の 特 化 比し 他 の て 高 い 値 が 得 ら れる。

I が 0.5以上で効率は依下値向を示すが、これは P 盤 n-81(1-x)C(x) の振伐が大きくさる事化 L るフイルフアクター (以下、PFと言う) の低下であり、短額電放 (以下 Jecという)はほとんど乗りなく、不発明の n-81(1-x)C(x) を用いる事化 L つて、 P 層での光数収 P スの減少化 L る Jec の増加と助放地圧 (以下、 Focという) の場割化 L り、効率の改良ができたものと考えられる。

これらの結果は Bille CB。を用いても全く何様。 であつた。

(次百へ続く)

P型 a=B1 $(1=x)^{\circ}$ (x) の美組取れよる太陽主義 特性を図って代示す。これ図から行っようだシラ

次代 a-81_(sa) (s_{sa)} の相級でBのドープ値を B/(81+C) で0.005 atcm がから2.0 atcm がと変 えて太陽智能を作り同様の側定を行つた。(図~3)。 又 P 差 a-81_(sa)O(sa) の意識にかける電気伝染率 のポロンドープ値依存性の変化は図~4 化示され ている。

ドーブ世が少ない時はアアとVocが低いがア型
a-B1の 時よりもはるかに良い効果(す)を示す。又ドーブ世が 0.5 章以上になると Jacが吹下する。 これは B を高機度に ドーブすると元の吸収係数が増大する為である。以上の太阳 単 和 号性と P 型 a-B1(au) の伝導数が10° (Ω・cm) 二 以上になるように ドーブするのが好ましい。

次氏 n 数 a-8i (i-x) C(x) を用いる実施例について説明する。ステンレス基金上氏 B-Ei を 1 モルッドーブした P 型 a-8i を 200 a.その上氏 1 型 a-8i を 5000 a さらに PEi でドーブした n 型 a-8i (i-x) C(x) を 100 a グロー放電分解して単独させる。 a-8iは

シラン 81H, を、 a-81(1-x) C(x) は 81H, と CB, を夫々用いてグロー放電分解した。さらに ITO を 電子ピーム振着して同様に太陽電差特性を飼べたo n型 a-Bi(1-x) O(x)のアのドーブ量をア/(Bi+C) = 0.δetomがとしてアトミツタフラクションエを 0.05 から 0.85 まで安全した場合の太陽電曲特性 を図ーSに示す。IがO.5までは任何連続的にJec が増加し、PP. Vocも増加する。一方 PPは エ>0.5 で低下している為にゃも低下するがエコ 0.5では安 換効率は 7.3 多にも改良されている。 n 雅 a-81 (図5中でエニリ)の場合を中4.9多でありエモ 0.05~0.95 の間で著しい改良を示す。 na-Bi(ed) Vol 36 Amorphous Semiconductors p=311 C(e-t) でのPのドープ量をP/(#1+C) = 0.005 ~2 atomがまで変えた時の太陽電池特性を図ー 6 に示す。ドーブ量の増加と共にJac, アッ , ₹oc が増加しているのが判かる。 n 種 a-81_(sa) (c_{oa)} の金組での電気伝導率のドープ量依存性(図ー4) からアのドープ量は電気伝導率が10°7(Ω・cm)** 以上であるようにするのが好せしいと言える。 シランのグロー放電分解でメダン、エタン等の

ヘイドロカーポンを混合してダロー放電分解して アモルフアスシリコンカーペイトの得られる事は 長に知られている [何えば D. A. Anderson and W. E. Spear , Phil. Mag. 35 , 1 (1977))o

しかしをがら、シランとメメンで得られる A-81_{t-X} C_x を真性領域に用いた太陽電池は、 D. L. Carlson らの実験によりメタンを含まない 場合、2.27多の効率が、10多のメタンを含む と1.4多に低下し、さらに30多のメメンを含む 場合、0.08 がと他端に 低下してしまり事が知ら れていた (何えば Topice in Applied Physics (M. H. Brodeky, Spring- Verlag Berlin Beidelberg 刊 1979年) o従つて、従来 はメメ ン等のハイドロカーボンは不満物として好せしく せいとされていた。

本発明者は、アモルフアスシリコンカーパイト をp差叉はn型にドーブしpin級合光電素子の窓 材料に利用して大巾な効率を改善したものであり、 その効果は無くべきものである。

4. 図面の効果を設明

図-1(A)はp駆倒から光を照射するメイプ心光 4.余子を示す構造図であつて、図中19はガラス、 2 0 は透明性性。 2 1 は p 豊 a - fi (i-x) C(x)。 2 2 11 1 型 e-81、23 11 n 型半導体 (例えば □型 a-Bi)、2 4 以電響である。何(以以 n 解像か から元を無射するタイプを示す構造因で、25m 年集基本、26は7型4-81、27は1型4-81、 2 8 は n型 a-Bi (,-x) C(x)。29 は透明電象である。 図-2 M p型 a-Bi_(i-x)O_(x)/i-n a-Bi ヘテロ 並合元編集子において、Bのドーブ量を B/ (81+C) = 0.1 atomがとした時のその変化による太陽電路 特性を示すグラフである。このグラフにおいて、 1は単語電視 Jac(mA/cm²)。 2はフィルファクタ - PF、3は開放電圧 Voc(volts)、4は重要効率 #(≶) である。図ー3は、p数 a-Bi(*.*)○(*.*)/ 1-D 4-BL ヘテロ級合党電常子において、 B むドー ブ盤を (81+0) 代対して 0.005~2.0 atom多と* 変えた時の太陽仙雄特性を示すダラフである。 5 は Jac . 6 11 17 . 7 12 Voc . 8 13 9 7 8 6 .

四一 4 は、 1-81(***)C(***) 裏にかいて?又はB のドープ量素化による富能での電気伝導率の変化 を示すグラフである。 9 はポロン(3)ドープ、10 は リン(Bドープの場合である。図ーSは、n型 a-Bi_(p-x)C_(x)/1-p a-Bi ヘテロ接合光電景子 ドシいてサン(Bのドープ量をア/ (81+G=0.5atom **ラとした時のミによる太陽電池特性の変化を示す** 「グラフである。1.1は Jec、1.2 は pp、1.3 は Voc、1 4 以 4 を示す。 因一 6 位、 5 離 a-81(9.4) O(a, t)/1-p a-81 ヘテロ接合先電象子において リン(P)のドーブ量を (81+c)に対して 0.005~ 2.0 stom多変化させた時の太陽電池特性を示すグ ラフである。15はJeo、16は77、17はVoo、 18ロッシ示す。

> 特許出職人 社団在人生重技術振興協会 代 迎 人 分置士内 田 敏 章













